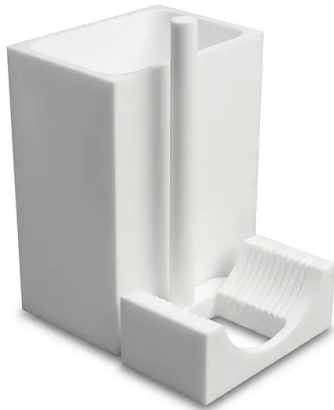


Cesto Floral Quadrado De Ptfе Para Limpeza De Wafers De Silício Personalizável Para Gravação A Úmido De Semicondutores E Manuseio De Substratos

Número do item: PL-CP88



introdução

Cestos florais de limpeza quadrada de PTFE de alta pureza projetados para processamento de wafers de silício. Este suporte resistente à corrosão garante gravação a úmido segura e manuseio de substratos na fabricação de semicondutores. Dimensões e configurações totalmente personalizáveis estão disponíveis para atender aos requisitos específicos de bancadas úmidas de laboratório ou industriais.

[Saiba mais](#)

Aplicação	Descrição	Principal Benefício
Fabricação de Semicondutores	Imersão de wafers de silício em soluções de limpeza RCA ou gravação Piranha para remover contaminantes.	Risco zero de contaminação metálica
Produção de Células Fotovoltaicas	Manuseio de wafers solares de grande formato durante as etapas de texturização e polimento ácido.	Alto rendimento e durabilidade
Processamento de Dispositivos MEMS	Transporte seguro de substratos microeletromecânicos delicados através de várias bancadas úmidas.	Posicionamento preciso do substrato
Limpeza de Vidro LCD/OLED	Limpeza de substratos de vidro condutivo (ITO/FTO) antes da deposição de filme fino.	Resistência química a limpadores de vidro
Pesquisa Laboratorial de Alta Pureza	Seguração de amostras durante análise de traços e processos agressivos de digestão química.	Resistência superior a meios corrosivos
Substratos de Nanotecnologia	Processamento de wafers de silício sobre isolante (SOI) ou safira em ambientes de pesquisa.	Manuseio suave de materiais frágeis

Categoria de Especificação	Detalhes do Parâmetro para PL-CP88
Identificador do Modelo	PL-CP88
Material Principal	Politetrafluoretileno de Alta Pureza (PTFE)
Dimensões Padrão	249mm x 249mm (Tamanhos personalizados disponíveis sob solicitação)
Geometria	Design de Cesto Floral de Moldura Quadrada
Opções de Personalização	Quantidade de Slots, Largura do Slot, Profundidade do Slot, Passo e Estilo da Alça
Faixa de Temperatura de Operação	-200°C a +260°C
Resistência Química	Universal (Exceto metais alcalinos fundidos e flúor de alta pressão)
Método de Fabricação	Usinagem de precisão CNC de ponta a ponta para especificações de alta tolerância
Acabamento Superficial	Acabamento de fluoropolímero liso, não poroso
Compatibilidade	Banhos de imersão manuais e braços robóticos de bancada úmida automatizados